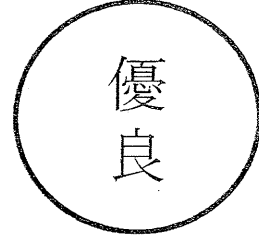


特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

住 所 東京都千代田区外神田四丁目14番1号
氏 名 エコシステムジャパン株式会社
代表取締役 石川 統一



廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第1項 の許可を受けた者であることを証する。
第14条の5第1項

徳島県知事 飯泉 嘉門



許可の年月日 令和2年8月18日

許可の有効年月日 令和9年6月30日

1. 事業の範囲

裏面記載のとおり

2. 積替え又は保管を行う全ての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ

該当なし

3. 許可の条件

なし

4. 許可の更新又は変更の状況

裏面記載のとおり

~~5. 積替え許可の有無~~

6. 規則第10条の12第2項の規定による許可証の提出の有無

有・無

1. 事業の範囲

(1) 積替え

なし

(2) 取り扱う特別管理産業廃棄物の種類

燃え殻 (カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含むことにより有害なものに限る。)

汚泥 (カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機磷化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1・4-ジオキサンを含むことにより有害なものに限る。)

廃油 (揮発油類、灯油類及び軽油類であるもの、又は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1・4-ジオキサンを含むことにより有害なものに限る。)

廃酸 (水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機磷化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1・4-ジオキサンを含むことにより有害なものに限る。)

廃アルカリ (水素イオン濃度指数12.5以上のもの、又は、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機磷化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1・4-ジオキサンを含むことにより有害なものに限る。)

ばいじん (カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含むことにより有害なものに限る。)

感染性産業廃棄物

廃ポリ塩化ビフェニル等 (低濃度PCB廃棄物に限る。)

ポリ塩化ビフェニル汚染物 (低濃度PCB廃棄物に限る。)

(以上9種類)

4. 許可の更新又は変更の状況

平成5年7月1日	新規許可
平成7年2月6日	変更許可
平成8年3月27日	変更許可
平成10年7月1日	更新許可
平成15年7月1日	更新許可
平成18年4月28日	変更届出 (代表者の変更)
平成18年10月24日	変更届出 (商号及び本店所在地の変更)
平成19年8月22日	変更届出 (代表者の変更)
平成20年7月7日	更新許可
平成20年7月18日	変更届出 (代表者の変更)
平成23年4月15日	変更届出 (代表者の変更)
平成24年9月26日	変更許可 (廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物の追加)
平成25年7月1日	更新許可
平成26年3月5日	変更許可 (汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの1・4-ジオキサンの追加)
平成28年4月18日	変更届出 (代表者の変更)
令和元年7月23日	変更許可 (廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物の限定内容の変更)
令和2年8月18日	更新許可

以下余白